



Optics & Photonics Japan 2006

日本分光学会極端紫外分光部会合同企画シンポジウム

EUV リソグラフィ技術の進展

日本分光学会では、顕微分光、テラヘルツ分光、赤外ラマン分光など9つの専門部会がそれぞれ独自の活動を行っています。本シンポジウムは日本分光学会極端紫外分光部会が企画しました。

波長 13.5 nm の EUV (極端紫外) 光を用いた EUV リソグラフィは 2009 年頃から量産されると考えられている、32 nm 技術ノード以降における半導体リソグラフィ技術として最有力視されており、現在、世界中で開発が急がれています。

このシンポジウムでは、レーザーや放電を用いたプラズマ光源から反射光学系、レジストまで、EUV リソグラフィ技術の開発現状と展望について、最先端の技術者・研究者に基礎から最新の技術まで、わかりやすくご講演頂きます。

会場 学術総合センター (一橋記念講堂) 〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2
営団地下鉄半蔵門線 / 都営地下鉄三田線・新宿線「神保町」A8,9 出口
営団地下鉄東西線「竹橋」1b 出口 徒歩 3~5 分

参加登録 OPJ2006 への参加登録が必要です。下記ホームページからお申し込みください。

日時 2006 年 11 月 9 日 (木) 9:55 ~ 15:00

プログラム

9:55-10:00 開会の挨拶

沖野 晃俊 (東京工業大学)

10:00-10:30 EUV リソグラフィの概要と開発の現状

小川 眞佐志 (EUVA)

10:30-11:00 レーザ生成プラズマ EUV 光源開発の現状

住谷 明 (EUVA)

11:00-11:30 リーディング・プロにおける LPP 光源開発の現状

井澤 靖和 (大阪大学)

11:30-12:00 LPP 光源用 Nd:YAG レーザー開発

中塚 正大 (大阪大学)

< 昼食 >

13:00-13:30 放電プラズマ EUV 光源開発の現状

佐藤 弘人 (EUVA)

13:30-14:00 東工大における高品位 DPP 光源開発

堀田 栄喜 (東京工業大学)

14:00-14:30 EUV リソグラフィ用光学系の開発

辻 俊彦 (キヤノン)

14:30-15:00 EUV リソグラフィ用レジスト技術開発の現状

西山 岩男 (ASET)

OPJ2006 ホームページ <http://www.opt-j.com/opj2006/>

連絡先(企画担当) 沖野 晃俊 (東京工業大学) aokino@es.titech.ac.jp